# 高纯钼颗粒9999钼溅射靶半导体材料

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 高纯钼颗粒9999钼溅射靶半导体材料 |
| 公司名称 | 北京环球金鼎科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:环球金鼎<br>型号:9999<br>产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市海淀区安宁庄东路23号2幢412室 |
| 联系电话 | 13269638621 |

# 产品详情

高纯钼颗粒9999钼溅射靶半导体材料

钼溅射靶可在各类基材上形成薄膜，这种溅射膜广泛用作电子部件和电子产品，如目前广泛应用的TFT-LCD、等离子显示屏、无激光发射二极管显示器、场发射显示器、薄膜太阳能电池、传感器、半导体装置以及具有可调谐功函数CMOS（互补金属氧化物半导体）的场效应晶体管栅极等。

在电子行业中，钼溅射靶材主要用于平面显示器、薄膜太阳能电池的电极和配线材料以及半导体的阻挡层材料，这些都是基于钼的高熔点。高电导率，较低的比阻抗、较好的耐腐蚀性以及良好的环保性能。以前，平面显示器的配线材料主要是铬，但随着平面显示器的大型化和高精度化，越来越需要比阻抗小的材料，另外，环保也是必须考虑的问题，而钼具有比阻抗和膜应力仅为铬的1/2的优势，而且不存在环境污染问题，因此成为了平面显示器溅射靶材的首选材料之一，此外，钼使用在LCD的元器件中，可使液晶显示器在亮度、对比度、色彩以及寿命方面的性能大大提升。

高纯度是对钼溅射靶材的一个基本特性要求，钼靶材的纯度越高，溅射薄膜的性能越好，一般钼溅射靶材的纯度至少需要达到99.95%，但随着LCE行业玻璃基板尺寸的不断提高，要求配线的长度延长、线宽变细，为了保证薄膜的均匀性以及布线的质量，对钼溅射靶材纯度的要求也相应提高，因此根据溅射的玻璃基板的尺寸以及使用环境，钼溅射靶材的纯度要求在99.99%-99.999%甚至更高，钼溅射靶材作为溅射中的阴极源，固体中的杂质和气孔中的氧气和水气是沉积薄膜的主要污染源。